

平成20年度 特許流通講座(実務編)

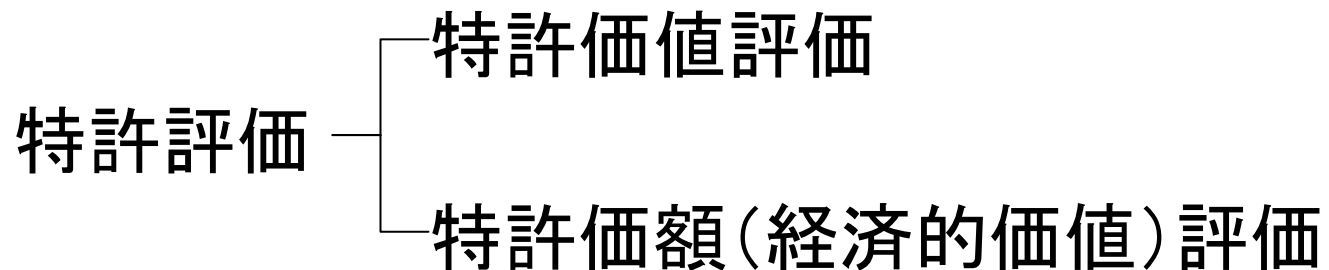
流通のための特許評価・実習

TCT研究会代表
株式会社ベンチャーラボ
シニアテクニカルナビゲーター
須貝 英雄

主催 独立行政法人工業所有権情報・研修館

特許評価とは

対象特許が有する技術内容・レベル、事業性の評価、及びそれに基づいた経済的価値の評価であり、下記の2つに大別される。



特許評価の意義・目的

(1) 特許評価の意義

- 特許評価を通じて、「良い特許とは？」が理解できるようになり、優れた特許の創造につながる
- 特許検索から出発して、権利要素、技術要素、市場要素すべてを調査・分析・評価することによって、いわゆる「目利き能力」の向上が図れる

(2) 特許評価の目的

- 技術の移転・流通：ライセンスの容易化
- 担保、出融資、証券化：金融支援の円滑化
- M&A
- 技術、事業の審査・格付け
- 係争に係わる鑑定
- 保有する特許の棚卸し、評価
- 特許の不良資産、優良資産の選別化
- 技術・商品開発戦略への活用 ……等

難しいといわれる特許評価

—特に特許価額評価について—

- 理論的には数多く開発・紹介されているが、実務上応用することが難しい。
- 将来における「不確定性(リスク)」の予測が困難。
- 評価要素としてのデータ、パラメーターの把握が困難。
あるいは把握可能であっても膨大な労力と時間を要する。
- 定性的評価と定量的評価とのマッチングが難しい。



ワンストップでの対応が困難

特許評価のあり方

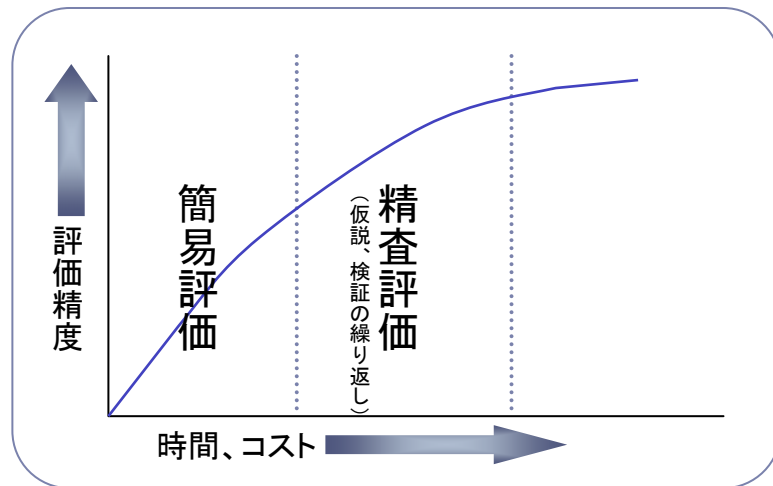
- フレキシビリティー

評価の目的及び評価時期を明確に把握し、それに適応した評価手法を適宜組み合わせる。

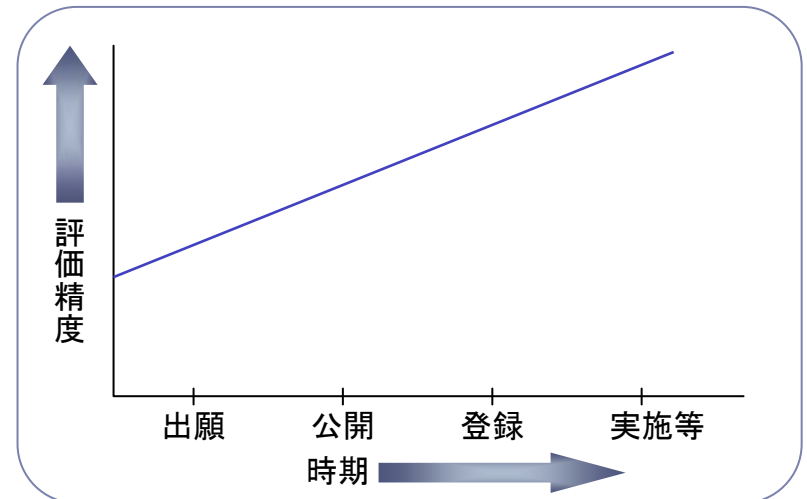
- 客観性、論理性、公平性の維持

- 評価者によるバラツキの抑制

<目的に対応した評価>



<評価時期に対応した評価>



特許評価の要件

< 特許価値評価 >

(1) 第1ステップ: 特許権自体の評価(権利固有評価)

権利化状況、権利の存続期間 等

(2) 第2ステップ: 技術内容に対する評価

技術レベル、代替技術との技術的優位性 等

(3) 第3ステップ: 市場性・事業性に対する評価

事業への寄与度、事業規模 等

< 特許価額評価 >

(4) 第4ステップ: 経済的価値、価額に対する評価

第1ステップから第3ステップの「特許価値評価」を踏まえて、主として下記の方法で評価する。

① コストアプローチ法(原価法)

研究開発あるいは特許を生み出すために費やされたコストを価値と見なす方法

② マーケットアプローチ法(取引事例比較法)

実際の市場において比較可能な類似の資産(特許)があり、その市場価格と比較して推定する方法

③ インカムアプローチ法

当該特許が将来生み出すであろうリターン・キャッシュフローを推定し、技術的・経済的耐用年数や割引率に基づいて現在価値を求め、それを当該特許権の価値とする方法

キャッシュフローをベースとした経済的価値評価(1)

当該特許権が今後n年間にわたって創出すると予想されるキャッシュフロー(CF)を現在価値に換算し評価する方法で、下記の式で表すことができる。前述のインカムアプローチ(収益還元法)に基づくものであり、現在価値の算出にはDCF法(Discounted Cash Flow)を適用している。ただし、実際的には、特にベンチャー企業や新規事業に関連する場合、長期にわたって将来のキャッシュフローを把握・推定するのが難しいケースが多い。

$$\text{現在価値} = \sum \{CF_n / (1+i)^n\}$$

キャッシュフローをベースとした経済的価値評価(2)

ここで、

・CF=キャッシュフロー(百万円)

データとして把握可能ならば、フリーキャッシュフロー[FCF:営業利益×(1-税率)+減価償却費-投資±運転資本の変化]とすることが望ましい

・n=期間

当該技術・特許等の存続期間・経済的耐用年数や減衰性(権利の安定性、技術の停滞・陳腐化)等も考慮に入れて、十分検討する必要がある

・ i =割引率(%)

割引率を構成する主要素としては、金利及びリスク等がある。リスクとは、別のいい方をすれば"不確実性"であり、企業の努力によって回避できるものと、マーケットリスクのように外部環境に支配され、企業努力のみでは回避が難しいものがある。実務的には当該技術・特許等の特性を考慮しながら、ある推定数値(例えば10%等)を適用する場合がある。

実施料率をベースとした経済的価値評価

この方式は、当該市場における類似業界及び類似技術・特許の実施料率を適用するという意味では、前述の取引事例比較法に準拠するものといえる。技術導入契約等の実施許諾契約において採用される実施料率を適用するもので、各種データの統計処理により数値間の比較が容易であるという特徴を有し、説得性もある。ただし、この評価方式は、当該特許が市場において取引の対象となり得るだけの価値を有していることが前提となる。例えば、データとして売上高が所与のものとして与えられた場合、下記の式で表すことができる。

$$\text{現在価値} = \sum \{ (S_n \times r) \times 1 / (1 + i)^n \}$$

ここで、

- ・ S_n = 各年度売上高(百万円)
- ・ n = 期間
- ・ r = 実施料率(%)

発明協会研究所編「実施料率」には、各技術分野(31分野)別実施料率データがイニシャルペイメント有り、イニシャルペイメント無し別に示されており、有効に活用できる。

- ・ i = 割引率(%)

特許庁方式による経済的価値評価

国等の公的機関の研究から派生する国有特許等を、民間が実施する場合に適用するために公表された実施料算定方法を応用して評価する方法である。その意味では、前記「実施料率をベースとした価値評価」に類似している。実務上では分かり易く使い易いものであり、下記の式で表すことができる。

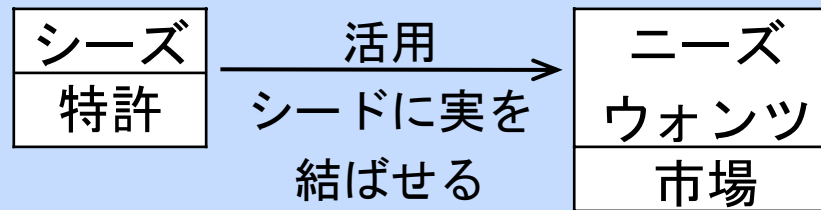
特許権の価値 = 基本額 × 実施料率 (基準率 × 利用率 × 増減率 × 開拓率)

通常、上記の結果を現在価値に換算して経済的価値とする。

基本額の設定には、販売価格、販売数量、生産数量、及び利益金額等のパラメーターが使用されている。その他各要素の定義については詳細にわたるためここでは省略する。詳しくは、発明協会研究所編「実施料率」を参照されたい。

特許評価の視点：有効特許とは

- 特許出願・取得の目的：「活用」
 - 自己実施（含起業）
 - ライセンス
 - 譲渡



- 特許が有する力
 - 武器性（攻撃、防御）
 - 財産性（ライセンス、交換、譲渡、担保、資本財等）

- 有効な特許とは：市場において活用可能な特許
活用不可能な特許は「金喰い虫」、「不良債権」

特許の価値評価における留意点

特に経済的価値評価において

(1) 当該対象特許によって具現化された商品・サービスについて

① 関連市場の規模

② 前記関連市場における商品・サービスの事業規模

③ 商品・サービスに対する特許の寄与度

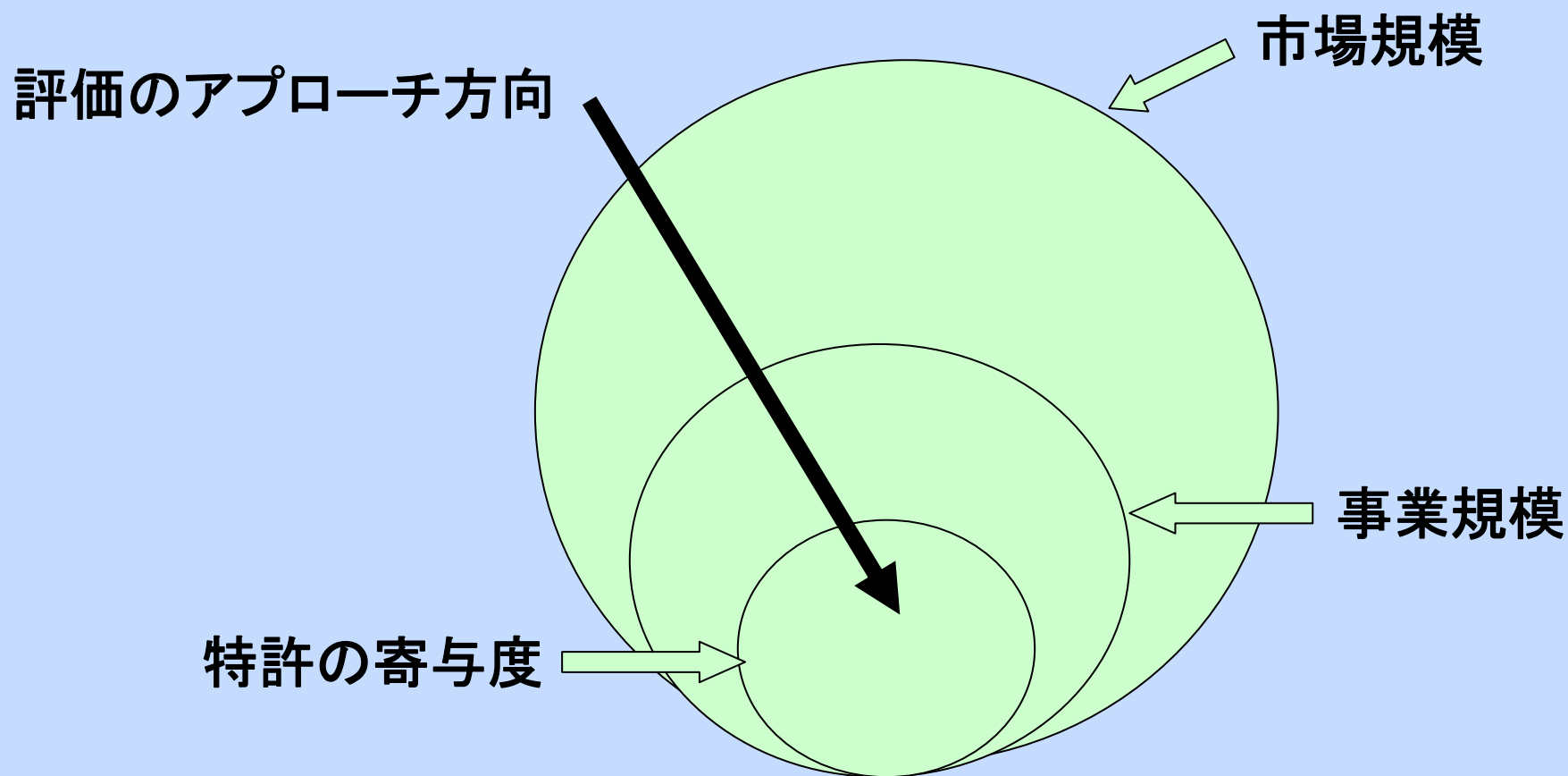
(2) 対象商品・サービスのライフサイクル(PLC)

代替商品・サービスの出現、新規参入者の増大等

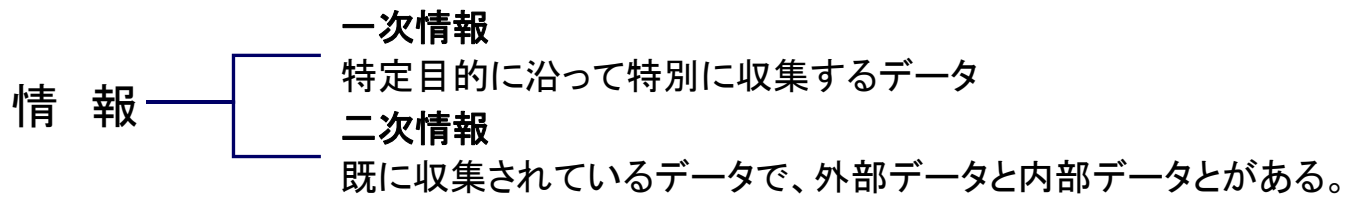
(3) 対象技術・特許のライフサイクル(TLC)

代替技術の出現、技術の陳腐化

特許の評価主要素



技術・特許評価のために必要な情報

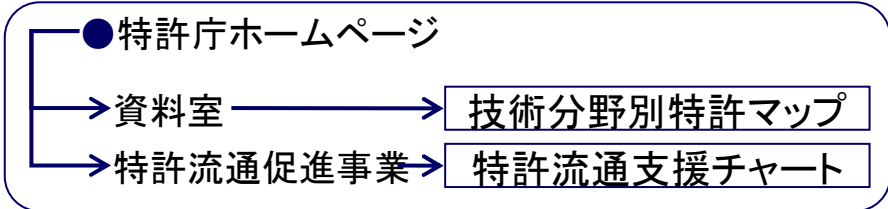


1. 特許の検索、調査

- 特許庁電子図書館 (IPDL)
- esp@cenet network : <http://gb.espacenet.com>
- パトリス ……等

2. 技術調査

- 特許
- 文献類
- 特許庁「技術分野別特許マップ」 ……等



- 論文・文献類
 - ・大学、TLO、企業等の技術情報誌、ホームページ
 - ・G-search等 情報データベースサービス ……等

3. 市場調査

- 企業内部諸情報
- インターネット情報
- 業界情報、銀行・研究所情報
- 白書類、調査・統計類
- 市場規模及び利益率推定表：特許庁「特許評価指標」（技術移転版）に添付 ……等
- 有料情報 ……等

4. 価額評価に必要な情報

- 財務諸表 (B/S、P/L)
- 有価証券報告書
- 中・長期経営計画
- 管理会計用データ ……等

技術分野別特許マップ

経済産業省

特許庁

Japan Patent Office

[ホーム](#) [ご意見・ご要望](#) [リンク](#) [\(独\)工業所有権情報・研修館マップ](#)

Google™カスタム検索

Search

特許について >>

実用新案について

意匠について >>

商標について >>

出願受付

国際出願

IT施策・出願関連

広報関連情報

サポートデスク

[HOME](#) >

資料室

■ 特許電子図書館 (IPDL)

(独)工業所有権情報・研修館のシンボルマークが新しくなったことに伴い、特許電子図書館 (IPDL) のURLが変更になりました。平成19年3月26日以降は以下のURLからご利用ください。

変更後のURL

<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>

☐ [特許電子図書館 \(IPDL\) からお知らせ](#)

☐ [提供サービス一覧](#)

☐ [特許電子図書館トップページ](#)

☐ [特許電子図書館 \(IPDL\) よくある質問](#)

☐ [産業財産権情報について](#)

■ 情報公開・個人情報保護

☐ [特許庁の情報公開へようこそ](#) 2007.8.1

☐ [特許庁の個人情報保護へようこそ](#) 2006.7.3

☐ [特許庁職員の贈与等報告書の閲覧を希望する皆様へ](#) 2005.7.11

■ 産業財産権関連法令

☐ [法令等法令データ提供システム/総務省行政管理](#)

特許流通支援チャート

特許流通支援チャート (パテントマップ・特許マップ) - Windows Internet Explorer

http://www.ryutu.inpit.go.jp/chart/index.html

Norton フィッシング対策オン IDセーフ ログイン

許流通支援チャート ウェブ検索 マーカー 特許流通支援チャート

特許流通支援チャート (パテントマップ・特許...

English

特許流通促進事業

About	人材活用による特許流通の促進	開放特許情報等の提供	知的財産権取引事業育成支援
特許流通促進事業について	特許流通アドバイザー	特許流通データベース 特許情報アドバイザー	知的財産権取引業者データベース 特許ビジネス市 国際特許流通セミナー 特許流通講座 特許流通シンポジウム

工業所有権情報・研修館へ
特許流通TOPへ

特許流通支援チャート

特許流通支援チャートのご案内

特許流通支援チャート二覧

関連リンク
サイトマップ
お問合せ

特許流通支援チャート

独立行政法人工業所有権情報・研修館では、特許情報からみた技術の解説書(パテントマップ/特許マップ)である「特許流通支援チャート」を発行しています(特許情報を分析し、その動向等をビジュアル化したものを一般的にパテントマップと呼んでいます。)

特許流通支援チャートは、技術テーマごとに過去10年間の特許情報を分析し、技術の成熟度、技術開発課題に対する解決手段の動向等を分かりやすく解説したものです。研究開発の方向性策定、異業種分野への進出や新たな事業展開の検討に際して、更には当該技術分野の技術シーズや特許保有企業の発掘の御参考として御活用下さい。

特許流通支援チャートは、以下のような構成となっています。

- 1 全体の要約
- 2 当該分野の体系的な技術説明
- 3 当該技術分野への特許情報のアクセス方法
- 4 出願人数と出願件数からみた技術成熟度分析
- 5 技術要素と技術開発課題、技術開発課題と解決手段の対応関係

ページが表示されました

インターネット | 保護モード: 有効 100%

特許流通促進事業

http://www.ryutu.inpit.go.jp/

Norton フィッシング対策オン IDセーフ ログイン

goo ウェブ検索 マーカー 国語 英和 和英

特許流通促進事業

English ▶

About	人材活用による特許流通の促進	開放特許情報等の提供	知的財産権取引事業育成支援
特許流通促進事業について	特許流通アドバイザー	特許流通データベース	特許情報アドバイザー
		知的財産権取引業者データベース	特許ビジネス市 国際特許流通セミナー 特許流通講座 特許流通シンポジウム

独立行政法人工業所有権情報・研修館
National Center for Industrial Property Information and Training

独立行政法人工業所有権情報・研修館 流通部

中小・ベンチャー企業や大学・研究機関等の知的財産活用を支援するため、特許流通促進に向けた各種事業を実施しています。

特許流通促進事業に関する質問や要望のお問い合わせは以下までお寄せ下さい。

お問合せ
関連リンク
サイトマップ

特許電子図書館 IPDL
特許流通DB SDI機能
特許流通コンテンツ

Measures for Encouraging Patent Licensing

新着情報

- 2009.01.28 ●特許ビジネス市
 - 平成20年度第4回特許ビジネス市の**当日発表資料**を掲載しました。
- 2009.01.26 ●特許流通シンポジウム
 - 「**特許流通シンポジウム2009 in 名古屋**」の**参加者募集を開始**しました。
- 2009.01.26 ●特許流通ニュースメール
 - 1月19日配信分を掲載しました。配信の登録は**こちら**から。
- 2009.01.20 ●国際特許流通セミナー
 - 国際特許流通セミナー2009は**終了**しました。
- 2009.01.14 ●特許流通ニュースメール
 - 1月9日配信分を掲載しました。

資料室

- 特許流通 ニュースメール
- 特許流通 ニュースレター
- 特許流通 コンテンツ(動画)
- 知っておきたい 特許契約の基礎知識
- イベント出展一覧
- 調査研究等報告書
- 開放特許情報
- 開放特許活用例集
- 特許流通 支援チャート

インターネット | 保護モード: 有効 100%

特許庁ホームページ:概要

 <p>経済産業省 特許庁 Japan Patent Office</p>	<p>ホーム ご意見・ご要望 リンク サイトマップ 〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号03-3581-1101(代表) 案内図</p>	<p>日本語 English</p>	<p>文字サイズ 小 中 大</p>	
	<p>特許について</p> <p>実用新案について</p> <p>意匠について</p> <p>商標について</p>		<p>検索</p>	
<p>出願受付</p>	<p>国際出願</p>	<p>IT施策・出願関連</p>	<p>公報関連情報</p>	<p>サポートデスク</p>
 <p>パソコン電子出願</p>				
 <p>特許電子図書館</p>		<p>特許行政サービス一覧</p>	<p>▶ 一覧へ</p>	
	<p>手続きが分からない時は？</p> <p>審査を早くするには？</p> <p>審査請求料の半額を返還請求するには？</p>	<p>料金が安くなる？</p> <p>審査を早くするには？</p> <p>出願書類等の様式はこちら</p>	<p>無料で先行技術が調査できる？</p> <p>手続料金自動計算システム</p>	
<p>メインコンテンツ</p>				
<p>特許庁の紹介</p> <p>採用情報</p> <p>施策情報</p> <p>国際動向</p> <p>広報</p> <p>法律・条約</p> <p>審議会・会議</p> <p>プレスリリース</p> <p>調達情報・公募情報</p> <p>意見提出手続</p> <p>弁理士試験</p> <p>統計</p> <p>印刷物</p> <p>知的財産権イベントカレンダー</p>		<p>トピックス</p> <p>更新情報</p>	<p>▶ 一覧へ</p>	
<p> 中小企業・個人向け支援情報</p> <p> 学校・大学向け支援情報</p> <p> 企業の知財戦略に役立つ情報</p> <p> 地域別の支援情報</p> <p> 知的財産権リンク集</p>				
<p>ホーム e-Gov プライバシーポリシー このサイトについて 情報公開 ご意見・ご要望 用語解説 リンク サイトマップ (独)工業所有権情報・研修館</p>	<p>Copyright © Japan Patent office and INPIT. All Rights Reserved.</p>			

IPDL特許電子図書館

操作方法に関するお問合せ先、ご利用に関する情報の案内です。

メンテナンス情報やお知らせ事項が掲載されています。

The screenshot shows the IPDL (Industrial Property Digital Library) homepage. The header includes the IPDL logo and the text '特許電子図書館 Industrial Property Digital Library'. A 'To English Page' link is visible in the top right. The main content area is divided into several sections:

- お問い合わせ先 (Contact Information):** Located in the top left, it provides the IPDL helpdesk contact details: 'IPDLヘルプデスク', '受付時間: 9:00-21:00', 'TEL: 03-5690-3500', and 'E: helpdesk@ipdl.inpit.go.jp'.
- ご利用について (Usage Information):** A list of links including '各サービスのご利用方法', 'FAQ(よくある質問と回答)', 'マニュアル等ダウンロード', 'ご利用上の注意', and 'セキュリティソフトの導入'.
- アンケートにご協力下さい (Survey Request):** A section with a small image of people.
- トピックス (Topics):** A list of recent news items with dates and titles, such as '2007/10/29 ・特許電子図書館(IPDL)初心者向け講習会(福岡)開催について'.
- メンテナンスのお知らせ (Maintenance Notice):** A section titled 'メンテナンスのお知らせ' with a '予定一覧' link, listing maintenance periods: '11月22日(木)20:00 ~ 11月26日(月)08:00' and '12月28日(金)20:00 ~ 1月4日(金)08:00'.
- 検索メニュー (Search Menu):** A grid of search options: '初心者向け検索', '特許・実用新案検索', '経過情報検索', '商標検索', '意匠検索', and '審判検索'.
- Right Sidebar:** A vertical list of links including '出願手続きについて', '出願方法・様式', '出願に必要な料金', 'パブリック出願', '工業所有権に関する一般的なご相談', '公開・資料のご提供', '公開・資料の閲覧', '特許情報のご提供', '特許文書データベース', '特許出願データベース', and '特許情報ADバナー'.

出願手続き及びその他の参考情報を確認することができます。

ここから各検索メニューを選択します。

特許・実用新案検索

以下のサービスが利用可能です。希望するサービスをクリックして下さい。

[特許・実用新案公報 DB](#)

文献番号から特許・実用新案の各種公報を検索できます。また、PDF 表示をすることもできます。

[特許・実用新案文献番号索引照会](#)

各種番号から特許・実用新案の各種公報を検索することができます。

[公報テキスト検索](#)

書誌的事項・要約・請求の範囲のキーワード、分類(FI・IPC)等から特許・実用新案の公報を検索できます。

[公開特許公報フロントページ検索](#)

キーワードまたは文献番号から公開特許公報のフロントページ(書誌的事項・要約・代表図面)を検索できます。

[特許分類検索](#)

特許庁内で利用しているFI・Fタームやファセット、IPCを用いて特許・実用新案の各種公報を検索できます。

[パテントマップガイダンス\(PMGS\)](#)

キーワードを用いてFI・Fターム、IPCの説明を参照できます。

[パテントマップガイダンス\(旧\)](#)

平成12年10月以前のFI・Fターム、IPCの説明を参照できます。

[PAJ 検索\(英語表示\)](#)

キーワードまたは文献番号から公開特許英文抄録(PAJ: Patent Abstracts of Japan)を検索できます。

[FI/Fターム検索\(英語表示\)](#)

特許庁内で利用しているFI/Fタームやファセットを用いて特許・実用新案の各種公報を検索できます。

[外国公報DB](#)

各国の特許文献を、文献番号から参照できます。また、PDF 表示をすることもできます。

[審査書類情報照会](#)

2003年(平成15年)7月以降の審査に関する書類等が文献番号から参照できます。

[コンピュータソフトウェアデータベース\(CSDB\)検索](#)

発行日・CSターム・フリーワード・書籍タイトル等からCSDBを検索し、文献を参照することができます。

特許電子図書館についてのご質問またはコメントはこちらへ

[IPDLヘルプデスク TEL:03-5690-3500 :helpdesk@ipdl.inpit.go.jp](mailto:helpdesk@ipdl.inpit.go.jp)

海外特許の活用

欧州特許庁 esp@cenet 一ホームページ

クイックサーチ [ホーム](#) | [コンタクト](#)

- ・キーワード検索 又は個人名や法人名(機関、会社など)の検索 [索](#)

高度の検索

- ・入力画面検索 [番号検索](#)

番号検索

- ・公報番号、出願番号または優先権主張番号による検索 [分類検索](#)

分類検索

- ・走査検索または欧州特許庁の分類システム検索

esp@cenet - NEWS

esp@cenetユーザーの皆様、さらに以下の機能を追加いたします。

- ・e・ 被引用の表示(Forward citations) : 現在閲覧している文献を引用している文献の一覧を表示します。
- ・文献の“詳細”および“請求”タブに、EPO翻訳データへのリンクを開設します。このリンクにて、英語文献についてはフランス語訳、ドイツ語訳、スペイン語訳を、フランス語、ドイツ語、スペイン語文献については英語訳をご覧いただけます。
- ・検索結果表にて、一画面に表示する文献数を現在の10~15件から20~30件に増加します。
- ・EP文献からRegister Plusへの直接リンクを開設します。ただしEuro-PCT文献については後日の対応となります。
- ・検索結果表示にて、一画面内。



Quick Search

Search with keywords, or for persons or organisations

Advanced Search

Search using any of the available fields

Number Search

Search using application, accession, publication or priority number

Classification Search

Browse or search the Classification System of the European Patent Office

[Help index ?](#)

News Flashes

Scheduled Maintenance

07.07.2005 - Please be advised that due to technical problems, some outages of esp@cenet Level II services were observed this morning. We apologise for any inconvenience caused.

[read more...](#)

Loading of JP frontfile publications resumed

We are pleased to inform you that the problem with JP frontfile images is solved, we have started Monday, 09.05.2005, to load the delayed frontfile. We expect to be totally up to date by next Monday, 16.05.2005.

[read more...](#)

Latest Updates

EP1551212	- 20050707
WO2005057999	- 20050623
US2005138697	- 20050623
US6912725	- 20050628
GB2409794	- 20050706
FR2864746	- 20050701
DE102004060396	- 20050707
JP2005137176	- 20050526

[read more...](#)

Local coverage:

▪ **EP1551212 - 20050706**

Welcome to esp@cenet®

Dear esp@cenet user,

We began our programme of roadshows for 2005 with two one-day events in Ireland. The Dublin Institute of Technology was our host, and provided a well equipped computer training suite. Over two days in February, more than fifty scientists, academics, patent agents, and tech. transfer specialists participated in intense programmes using esp@cenet to search, retrieve and study patent documents. A typical roadshow familiarises the participants with the basic search functions and database coverage of esp@cenet. Then the pace quickens and advanced search functions such as ECLA search are introduced in prepared case studies. The participants are later assigned open-ended, but tough, exercises to test their newly gained knowledge. The day ends with an open Q&A session and discussion of participants' own search cases if required. Our aim is always to make the experience memorable, relevant and fun. The roadshows are complemented with comprehensive documentation about esp@cenet, patent information, the EPO and patents in general. If you think you could benefit from an esp@cenet roadshow contact Lisa McDonald-Maier or Nigel Clarke for further details.

- Release notes and known issues.
- Some basic things you should know about esp@cenet.
- Some basic things you should know about searching.



参考：経済産業省発行の各種産業別統計資料

タイトル	刊行時期	担当課
鉱工業指数年報	毎年6月	経済解析室
地域別鉱工業指数年報	毎年11月	経済解析室
工業統計表※※ 概要版 産業編※ 品目編※ 用地・用水編※ 市区町村編※ 工業地区編※ 企業統計編※ 産業細分類別統計表 我が国の工業(全数調査年)	翌々年1～10月	産業統計室
工業統計詳細情報※	翌々年6月	産業統計室
商業統計表※※ 商業統計速報 産業編(総括表)※ 産業編(都道府県表)※ 産業編(市区町村表)※ 品目編※ 業態別統計編※ 流通経路別統計編※ 立地環境特性格別統計編※ 我が国の商業	翌年4月～翌々年2月	産業統計室
特定サービス産業実態調査報告書 (業種毎分冊)	翌年11月	産業統計室
石油等消費構造統計表	翌々年3月	産業統計室
本邦鉱業の趨勢	翌年9月	産業統計室
鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報※	毎年6月	鉱工業動態統計室
化学工業統計年報※	毎年6月	鉱工業動態統計室
窯業・建材統計年報※	毎年6月	鉱工業動態統計室
機械統計年報※	毎年6月	鉱工業動態統計室
繊維・生活用品統計年報※	毎年6月	鉱工業動態統計室
紙・パルプ・プラスチック・ゴム製品統計年報※	毎年6月	鉱工業動態統計室
資源・エネルギー統計年報※	毎年7月	鉱工業動態統計室
石油等消費動態統計年報	毎年7月	鉱工業動態統計室
商業販売統計年報	毎年6月	産業統計室
企業活動基本調査報告書 総合統計表 事業多角化等統計表 子会社等統計表	翌年11月	企業統計室
我が国企業の海外事業活動	翌々年3月	企業統計室
外資系企業の動向(磁気媒体による刊行物)	翌々年3月	企業統計室

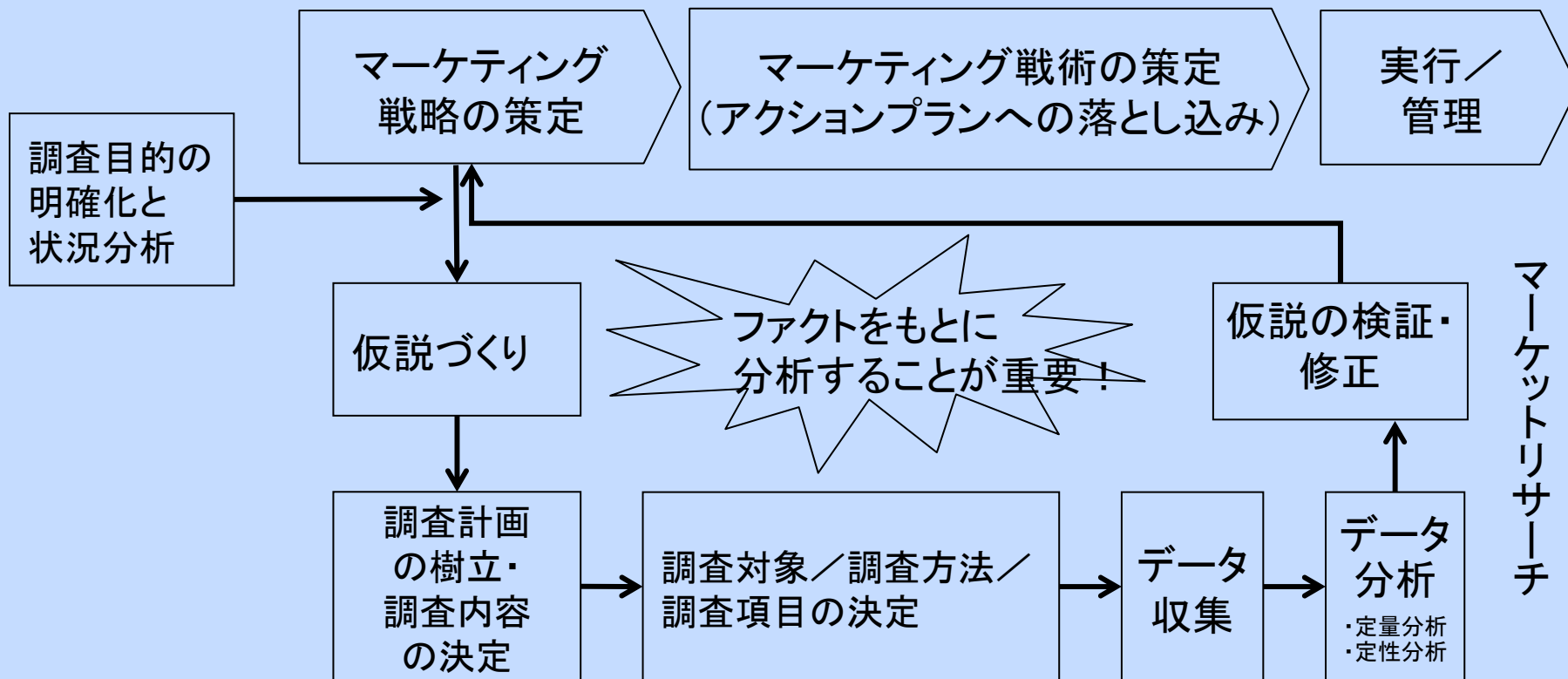
最新の情報：

<http://www.meti.go.jp/intro/aboutmeti/>

※の刊行物はCD-ROM及び磁気テープ等でも販売されています。

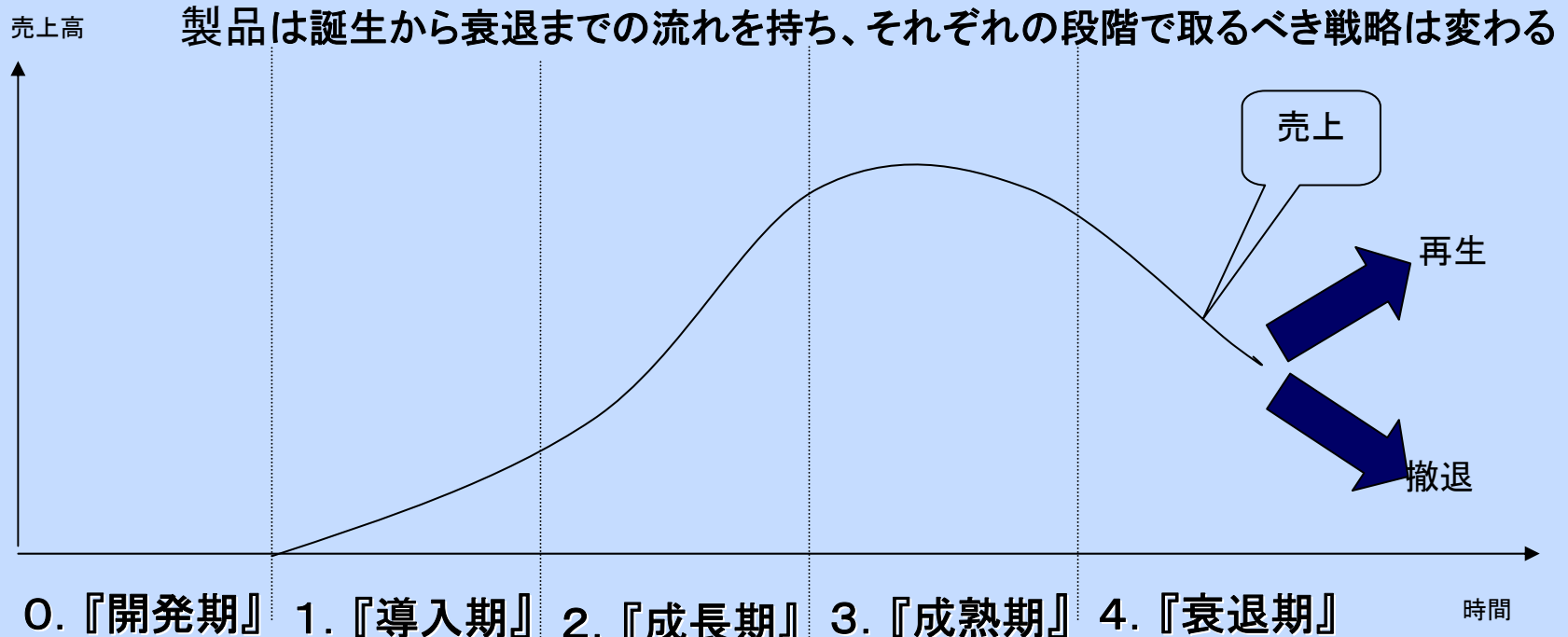
※※は分冊で発行されます(各々発行所、刊行時期が異なります)。

あらかじめ仮説を持った上で調査を実施し、分析によって検証、
仮説を修正する



- 調査方法
- (1) アンケート調査: インターネット、郵送等
 - (2) ヒアリング調査: 訪問面接、電話等
 - (3) インタビュー調査: パーソナルインタビュー、グループインタビュー等

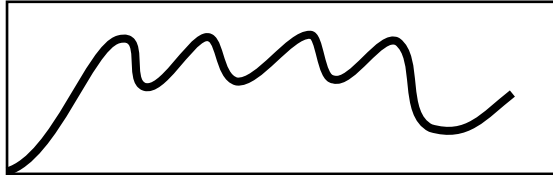
プロダクトライフサイクル(PLC)分析



製品が生産されてから廃棄されるまでを、人間の一生に例えて指標化したもので、『導入期』『成長期』『成熟期』『衰退期』の4つに分かれる。

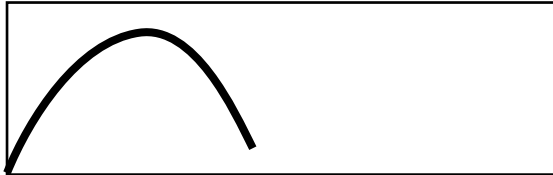
0. 『開発期』: 製品を開発している期間。製品が市場に投入されていないため売上げは無く、開発費用により利益がマイナスとなる。
1. 『導入期』: 製品が開発され市場に導入されるまでの時期。市場に浸透していないため、製品の知名度、売上共に低く、利益は期待できない。
2. 『成長期』: 製品が市場に浸透し始めてから完全に浸透するまでの時期。売上高も右肩上がるため、生産量の増大に伴いコストの削減も期待できる。しかし、競合他社が追随し、次々と市場に参入してくるため、それらとの差別化が必要になる。
3. 『成熟期』: 製品が市場に完全に浸透し、需要が飽和した時期。需要が飽和しているため差別化が難しくなり、プロモーション活動以外にも、パッケージや製品のデザインなど様々な面での差別化が必要になる。
4. 『衰退期』: 製品のニーズがなくなり、売上高も利益も下降をたどる時期。一般的には製品が時代のニーズに合わなくなることに起因しているため、差別化を行っても効果はない。撤退(廃棄)や新製品導入のタイミングを見計らうことが重要となる。

さまざまな製品ライフサイクル



スタイル

流行のスタイルが出るごとに市場が活況を呈する



ファッション

おだやかに成長し、おだやかに衰退する



ファド(ブーム)

急激に成長し、急激に衰退する



遅咲き型

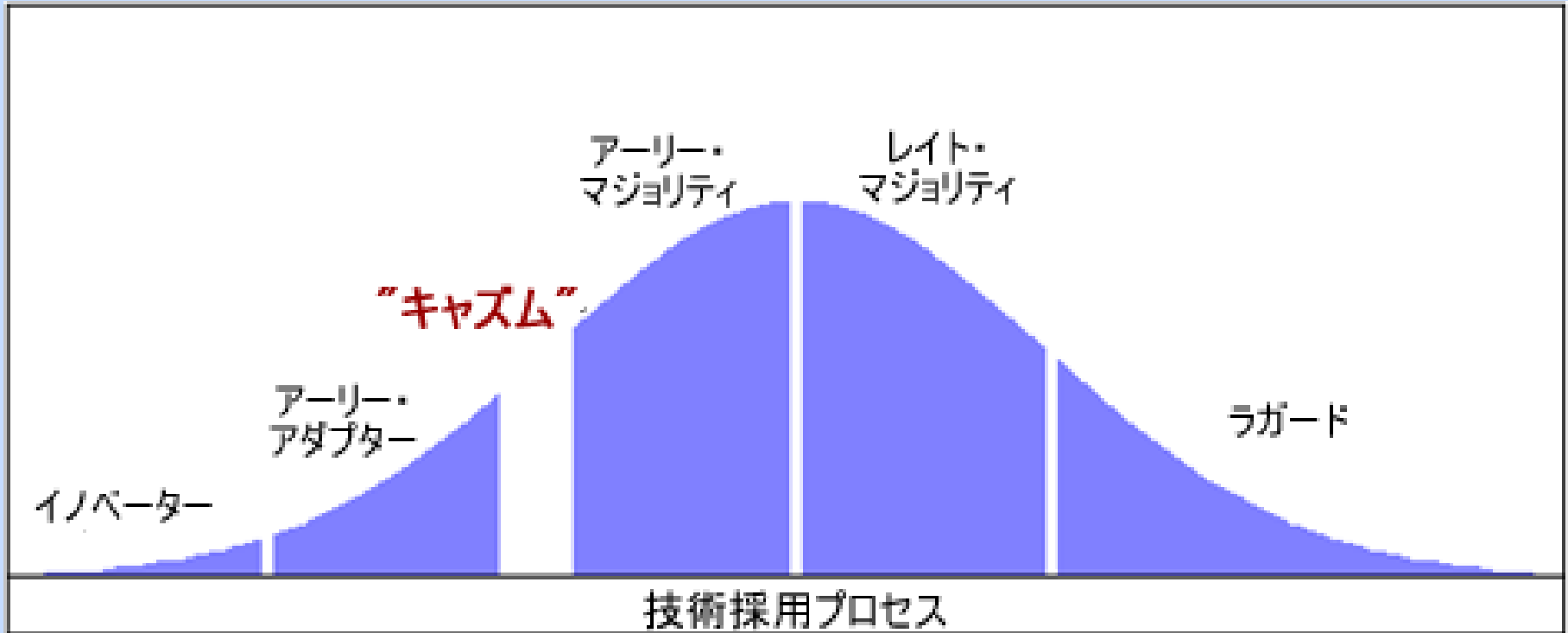
何かのきっかけでブレイクする



持続型

いわゆるロングセラー


ギャズム理論



出所:ジェフリー・ムーア著 『ギャズム』 翔泳社

- ・ギャズムとは: Chasm(深い割れ目)。ニッチ市場をターゲットとすること等によるギャズム超が必要。そこから関連する新たなニッチ市場を生み出し、さらには大量販売市場に採用されてゆく。
- ・ギャズムの例: ジャイロバランス式電動スクーター、水素燃料電池等
- ・ギャズムを超えた例: 犯罪捜査における)DNA鑑定、(運輸・物流産業における)RFIDタグ等

評価に必要な論理的思考、問題解決へのアプローチ法

- 演繹法と帰納法による論理展開:それぞれの長所を生かした論理展開が必要
 - ・演繹法:一般的原理から論理的推論により結論として個々の事象を導く方法
二つの情報を関連付けてそこから結論を必然的に導き出す三段論法的思考方法
「人間はいつかは死ぬ。」→「ソクラテスは人間である。」→「したがって、ソクラテスはいつかは死ぬ。」
 - ・帰納法:個々の事象から事象間の本質的な因果関係を推論し、結論として一般的原理を導く統計論的方法
「人間Aは死んだ。人間Bも死んだ。人間Cも死んだ。」→「人間だから死んだ。」→「人間はいつかは死ぬ。」
- 仮説の設定:評価コストの低減、評価精度の向上のために
仮説の設定→調査・分析→検証

- 問題解決のための因果関係の把握・分析
 - ・「5なぜ」の展開
 - ・「MECE」(漏れなくダブリなく)的展開による分析精度の向上

コメントの書き方

- 感想文的表現はNG
- 表現において、「・・・と思われる」、「may be」はNG。評価が難しい場合でも、「・・・と推論する」or「・・・と判断する」とする。
- copy & paste: 特に特許評価の明細書引用等に見受けられる。単なる引用ではなく、それに対する見解・評価が入ればOK。
- 文章構成上の留意事項
 - ピラミッド型に構造化された文章構成とすること。『MBAクリティカル・シンキング』(ダイヤモンド社: 株式会社グロービ著) 152頁参照。
 - ・箇条書きのみの表現はNG。項目間の論理的なつながりが薄れやすくなるため。先に論理的なつながりを示す文章(接続詞や助詞等をうまく使う)があって、それを受けて簡潔に箇条書きする場合はOK。演繹的、帰納的見地からの論理構造チェックも行う。
 - ・箇条書きについても、項目羅列型ではなく、各項目をピラミッド型に構造化し、あるいは類型化する。

例) A企業のB事業については、.....

.....

(1) 事業優位性

.....

①.....

(2) 事業遂行力

.....

①.....

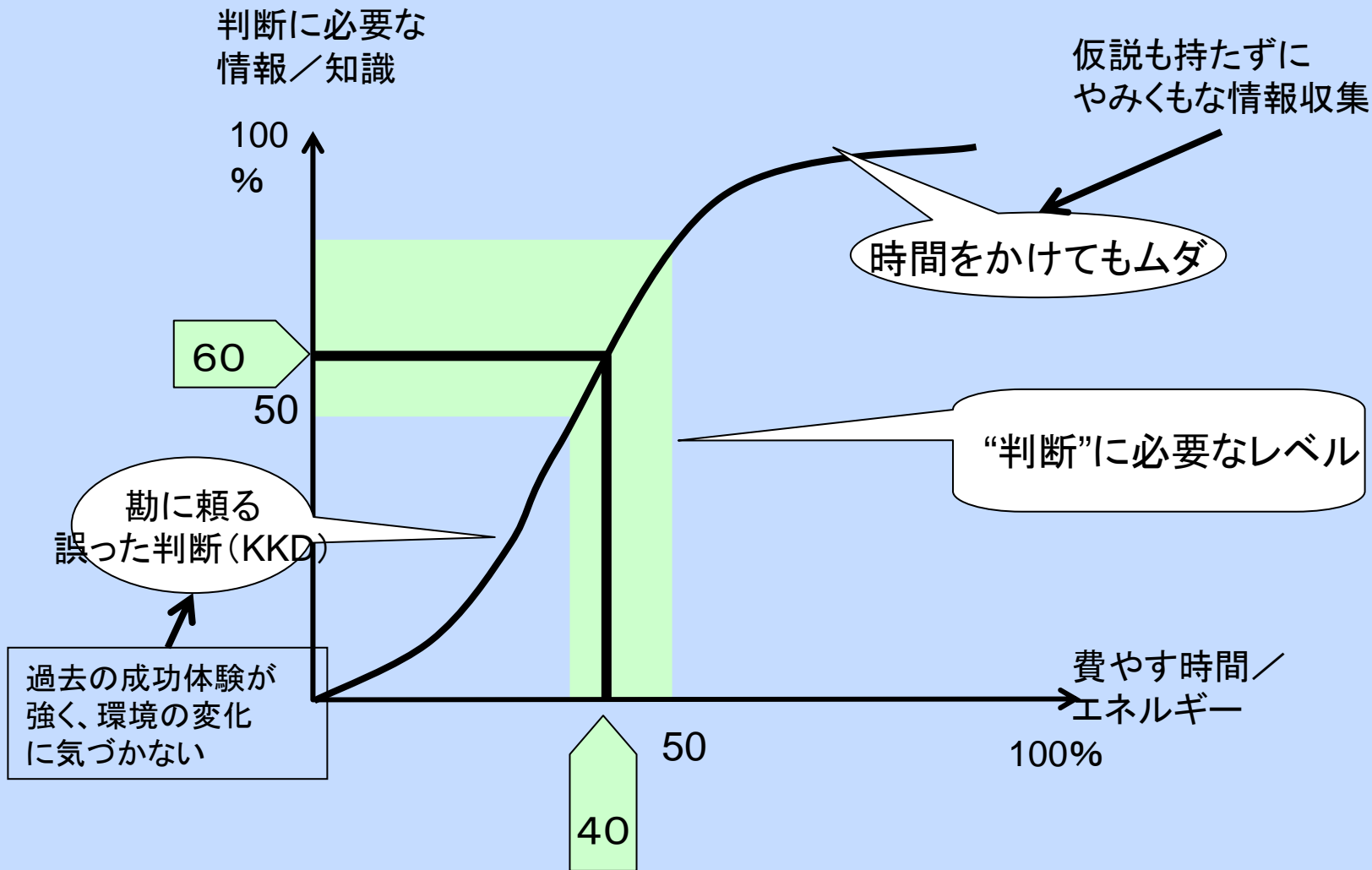
(3) その他特定項目

.....

①.....

40-60のルール

-K: 経験、K: 勘、D: 度胸のみではNG-

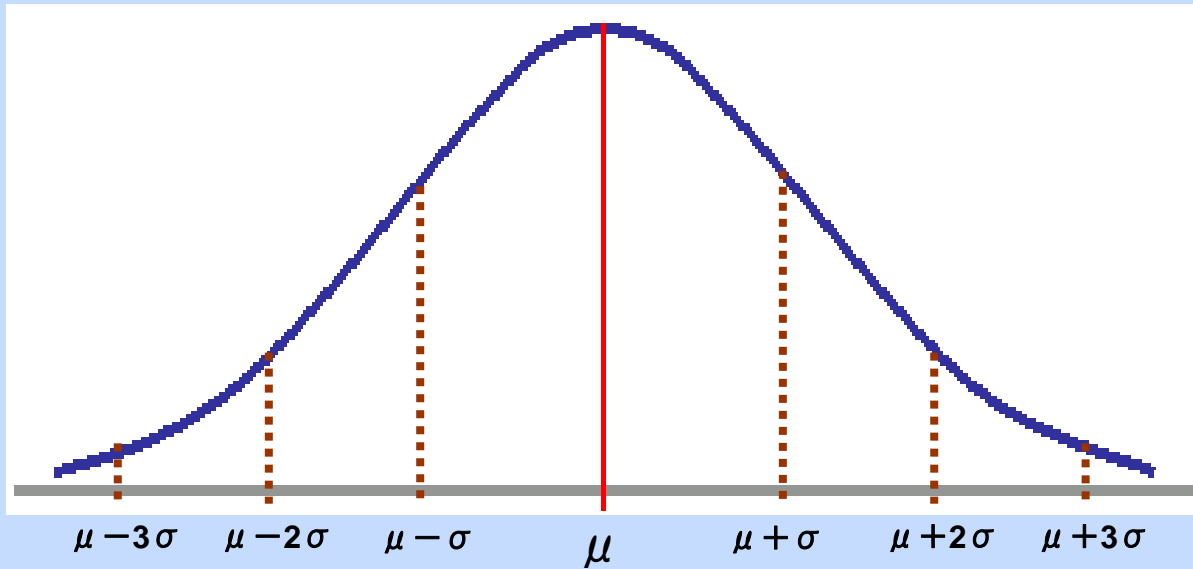


必要なのは右か左かの方向性...6割レベルの情報量での判断

評価結果の分布

最初にスクリーニング等一次評価を行わなかった場合には次図のような正規分布をする。

正規分布図



$\mu - \sigma$ から $\mu + \sigma$ の面積	約68.3%
$\mu - 2\sigma$ から $\mu + 2\sigma$ の面積	約95.4%
$\mu - 3\sigma$ から $\mu + 3\sigma$ の面積	約99.7%

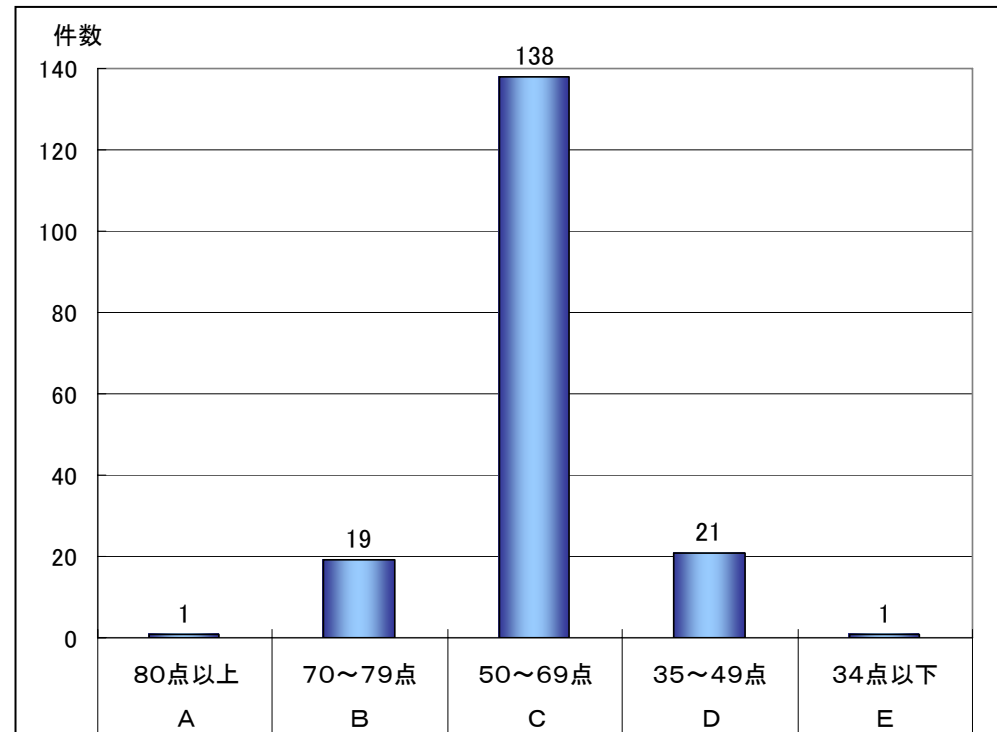
特許の評価実績例

株式会社ベンチャーラボが過去に行ったA総研保有特許の価値評価結果を下記する。なお、経済的価値評価は含んでいない。

評価結果

ランク	得点(合計点)	件数
A	80点以上	1
B	70~79点	19
C	50~69点	138
D	35~49点	21
E	34点以下	1

Cランク:50点台37件、60点台101件



特許評価のあるべき姿

- ワンストップでの対応

「特許評価の要件」における、第1ステップから第4ステップまでの全段階に関し、ワンストップでの対応を可能とすること。

- 豊富なスタッフ陣によるチーム編成

知的財産における専門家、技術における専門家、マーケティングにおける専門家等から成るスタッフ陣のラインアップとカバレッジをベースに、目的に応じて適宜チームを編成し対応する。例えば、自企業保有特許の価値、価額を精度高く評価する場合、知財部門を中心として、技術部門、販売部門、経理部門の連携が必要。

以下の評価要素は、単に登録後の評価のための要素と考えるのではなく、特許出願時の選別、ウェイト付けの要素と考える。それが特許の不良資産化を減少させる手段ともなる。

評価シート

特許評価指標(技術移転版)評価シート 特許庁版

A. フェイス項目

1. 発明の名称 _____
2. 特許(または出願)番号 _____ (外国出願があれば記入 _____)
3. 出願日 _____ (存続期間 _____ 年 _____ 月)
4. 権利者(または出願人)名 _____
5. 作成日 _____
6. 評価者 _____
7. 評価の視点 _____ (対象特許をどの様な視点から評価しましたか?)

B. 権利固有評価

該当する箇所(点数)に○を付ける。

◎権利としての技術支配力	評 価 内 容					
1. 特許の権利化状況	無効審判・異議決定後も権利維持 5点	権利成立(異議決定なし) 4点	出願中で権利未成立(含む審査未請求)で特許性の判断が困難なもの成立後、異議又は無効審判中 3点	拒絶査定を受け審判継続中 出願中で権利未成立(含む審査未請求)で特許性に疑問のあるもの 2点	拒絶査定を受け訴訟継続中 出願中で権利未成立(含む審査未請求)で特許性がないと判断できるもの 1点	拒絶査定確定(無効確定) →総合評価Eへ 0点
2. 権利の存続期間	15年以上 5点	10年以上 4点	5年以上 3点	3年以上 2点	1年以上 1点	1年未満又は失効 →総合評価Eへ 0点
3. 発明の技術的性格	基本技術の発明 5点	基本技術に準ずる発明 4点	大幅な改良技術の発明 3点	中程度の改良技術の発明 2点	小幅な改良技術の発明 1点	
4. 権利としての強さ	非常に強い 5点	強い 4点	中程度 3点	弱い 2点	非常に弱い 1点	
5. 抵触可能性 (第3者保有権利との利用関係)	抵触する権利なし 5点	同一権利者のライセンス意思のある抵触する権利あり 4点	他権利者のライセンス意思のある抵触する権利あり 3点	同一権利者のライセンス意思不明の抵触する権利あり 2点	他権利者のライセンス意思不明の抵触する権利あり 1点	ライセンス意思のない抵触する権利あり →総合評価Eへ 0点
6. 代替技術との技術優位性	代替技術なし 5点		代替技術はあるが技術的には優位 3点		代替技術があり技術的優位性がない 1点	
◎技術としての完成度						
7. 発明の実証度合い	製品レベル 5点	試作品レベル 4点	実証実験レベル 3点	数値計算レベル 2点	アイデアレベル 1点	

合計点: _____ 点 B項得点: _____ 点 (=合計点/35×100)

(○付けしたものを加算) 注記: 全項評価が原則である。ただし、評価しない場合はその分だけ分母(5点/項)を減点する。

C. 移転流通性評価

該当する箇所(点数)に○を付ける。

◎技術移転の信頼性	評 価 内 容				
1. 事業化に向けた追加開発の必要性	必要なし 5点	小規模かつ短期間の追加開発で済む 4点	中規模かつ中程度の期間の追加開発が必要 3点	大規模かつ長期間の追加開発が必要 2点	非常に大規模でかつ長期間の追加開発が必要 1点
2. 技術導入後の「権利者・継続開発技術」の支援の有無	技術支援不要、または継続技術を全面的に享受できる 5点	十分に享受できる 4点	一部享受できる 3点	享受に不安がある 2点	享受できない 1点
3. 技術導入時の技術指導の有無	技術指導不要、または技術指導を無条件で受けられる 5点	比較的低い対価で技術指導を受けられる 4点	相当の対価を支払って技術指導を受けられる 3点	指導を受けることは難しい 2点	技術指導を受けられない 1点
4. ライセンス制約条件	独占的通常実施権、専用実施権、購入可能(制約なし) 5点	独占的通常実施権、専用実施権、購入可能(他の制約あり) 4点	非独占の通常実施権のみ可能で、その他の制約なし 3点	非独占の通常実施権のみ可能で、その他の制約あり 2点	独占的通常実施権、専用実施権の設定あり 1点
◎権利の安定性					
5. 権利者の侵害対応義務や協力	権利者に完全な侵害対応の義務あり 5点	権利者に侵害対応義務があるが、履行に不安あり 4点	権利者の侵害対応協力あり 3点	権利者の協力が不安あり 2点	権利者の侵害対応なし 1点

合計点: 点 C項得点: 点(=合計点/25×100)

(○付けしたものを加算)

注記: 全項評価が原則である。ただし、評価しない場合はその分だけ分母(5点/項)を減点する。

D. 事業性評価

該当する箇所(点数)に○を付ける。

◎発明の事業化可能性	評 価 内 容				
1. 事業障害 ・事業実施に当たって	許認可の制約なし、他の障害もなし 5点	許認可や障害対応は容易である 4点	許認可や障害対応に期間・費用が掛かる 3点	許認可や障害対応に相当の期間・費用が掛かる 2点	対応が困難である 1点
2. 特許の事業への寄与度	非常に大きい 5点	大きい 4点	中程度 3点	小さい 2点	非常に小さい 1点
3. 代替技術出現の可能性	可能性なし 5点	可能性は低い 4点	可能性あり 3点	可能性は高い 2点	実在する 1点
4. 侵害対応の容易性	きわめて容易 5点	きわめて容易だが、費用等の制約有り 4点	容易 3点	困難 2点	実質的に不可能 1点
◎事業化による収益性					
5. 事業規模	非常に大きい 5点	大きい 4点	中程度 3点	小さい 2点	非常に小さい 1点
6. 収益期待額	非常に大きい 5点	大きい 4点	中程度 3点	小さい 2点	非常に小さい 1点

合計点: 点 D項得点: 点(=合計点/30×100)

(○付けしたものを加算)

注記: 全項評価が原則である。ただし、評価しない場合はその分だけ分母(5点/項)を減点する。

想定する事業実施者

想定する事業内容

特許簡易評価シート 例1

簡易評価シート I

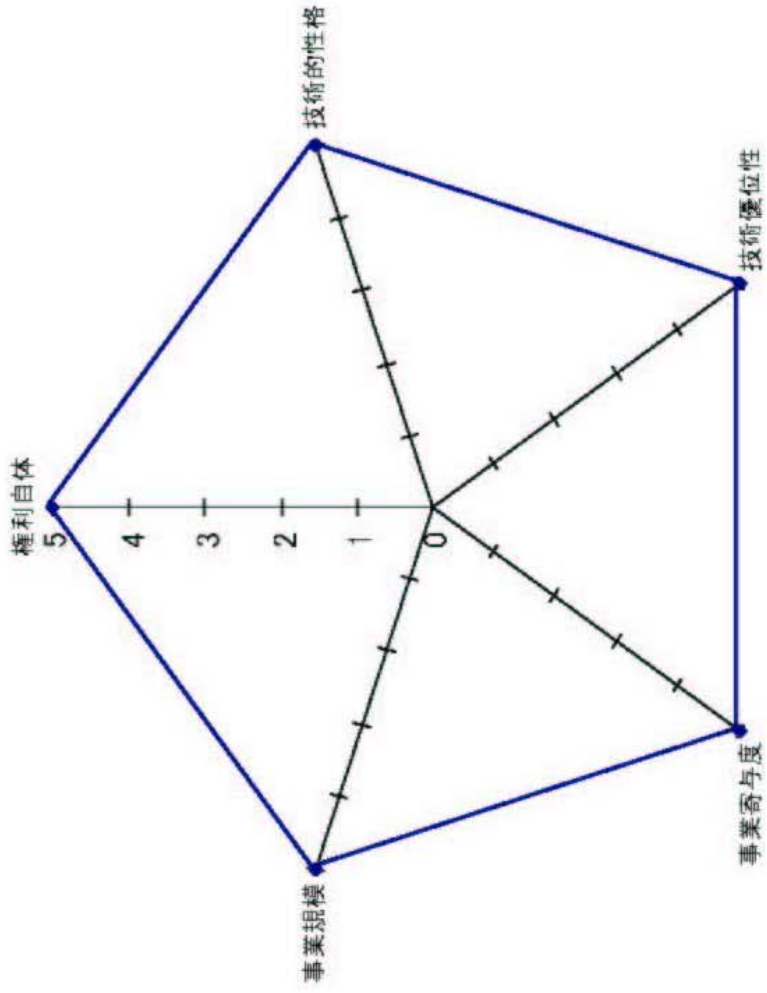
I. フェイス項目

NO	項目	内容
A-1	発明の名称	
A-2	特許/出願番号	
A-3	出願日 存続期間	
A-4	権利者 出願人	
A-5	発明者	
A-6	作成日	
A-7	評価者	

II. 評価結果 (表-1の評価基準参照)

評価項目	内 訳	コメント	点数						
			2.5	2	1.5	1	0.5	0	
権利自体 の評価	特許の権利化状 況		2.5	2	1.5	1	0.5	0	
	権利の存続期間		2.5	2	1.5	1	0.5	0	
技術・内容 面での評 価	発明の技術的性 格		5	4	3	2	1	—	
	代替技術との技 術的優位性		5	4	3	2	1	—	
事業性の 評価	特許の事業への 寄与度		5	4	3	2	1	—	
	事業規模		5	4	3	2	1	—	

Ⅲ. レーダーチャート



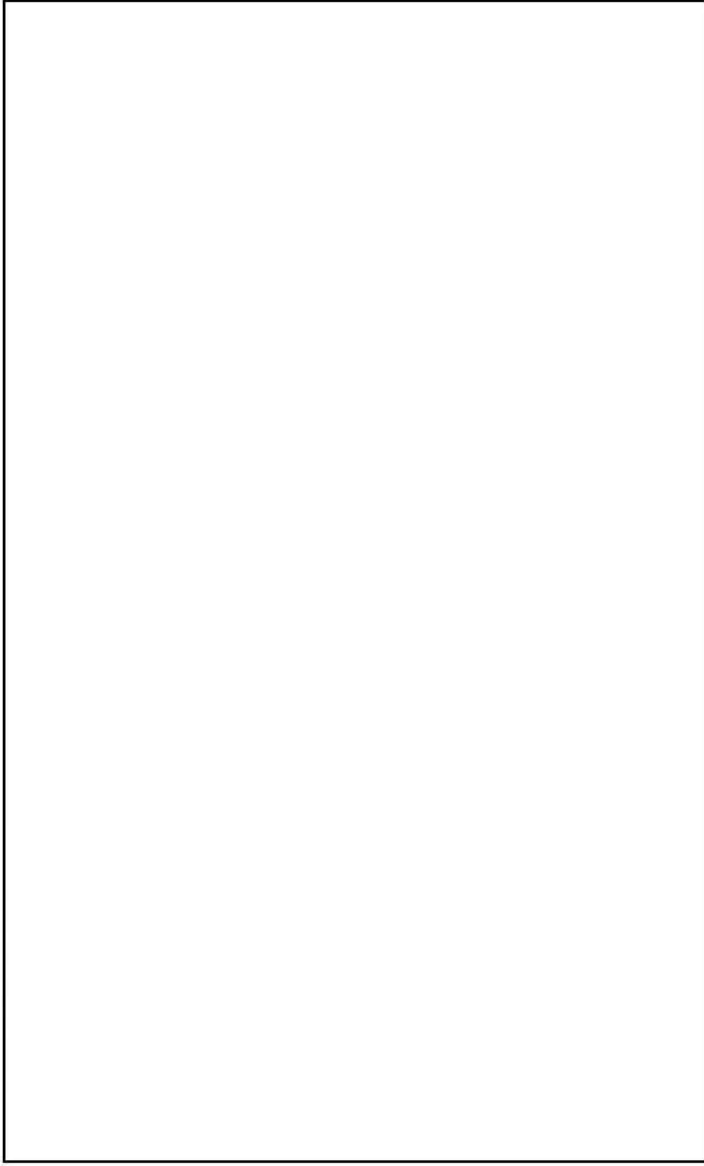
Ⅳ. 総合評価

得点 : ____点 (= 点 × 4)

ランク : A B C D E

ランク	得点(合計点)
A	80~100点
B	70~79点
C	50~69点
D	35~49点
E	34点以下

V. 特記事項：講評



以上

表一 1 評価基準内容

評価項目		評価内容					
権利自体の評価	特許の権利化状況	無効審判・異議決定を経て権利成立 (2.5点)	異議決定無しで権利成立 (2点)	・出願中、権利未成立(含む審査未請求)で、特許性の判断が困難なもの ・成立後、異議又は無効審判中 ・実用新案・無審査登録 (1.5点)	・拒絶査定を受け審判継続中 ・出願中、権利未成立(含む審査未請求)で、特許性に疑問のあるもの (1点)	・拒絶査定を受け訴訟継続中 ・出願中、権利未成立(含む審査未請求)で、特許性がないと判断できざるもの (0.5点)	拒絶査定確定 (無効確定) (0点)
	権利の存続期間	15年以上 (2.5点)	10年以上 (2点)	5年以上 (1.5点)	3年以上 (1点)	1年以上 (0.5点)	1年未満又は失効 (0点)
発明の技術的性格	発明の技術性格	基本技術の発明 (5点)	基本技術に準ずる発明 (4点)	大幅な改良技術の発明 (3点)	中程度の改良技術の発明 (2点)	小幅な改良技術の発明 (1点)	-
	代替技術との技術優位性	代替技術無し (5点)		代替技術はあるが技術的には優位的には優位 (3点)		代替技術があり技術的優位性が無い (1点)	-
特許の事業への寄与度	特許の事業への寄与度	非常に大きい (5点)	大きい (4点)	中程度 (3点)	小さい (2点)	非常に小さい (1点)	-
	事業規模	非常に大きい (5点)	大きい (4点)	中程度 (3点)	小さい (2点)	非常に小さい (1点)	-

注) 権利自体の評価で0点が出た場合は、それ以上評価作業は進めない。

簡易評価シート II

I. フェイス項目

NO	項目	内容
A-1	発明の名称	
A-2	特許／出願番号	
A-3	出願日 存続期間	
A-4	権利者 出願人	
A-5	発明者	
A-6	作成日	
A-7	評価者	

II. 各評価項目

1. 権利自体の評価（特許権利化状況＋権利の存続期間）

<評価の視点>

- ・特許の権利化状況と権利の存続期間とする。
- ・特許の権利化状況については、権利化に際し、他社がどの程度異議して成立したもののか、未成立か、あるいは拒絶査定を受けているかなどの位置付けを明らかにするものである。
- ・権利の存続期間については当然長い方が価値が高く、この期間の長さを尺度とする。

<評価及びコメント>

1

<採点基準及び採点>

A. 特許の権利化状況

- ① 無効審判・異議決定を経て権利成立 (2.5点)
- ② 異議決定無しで権利成立 (2点)
- ③ ・ 出願中で権利未成立 (含む審査未請求)
で特許性の判断が困難なもの
・ 成立後、異議又は無効審判中
・ 実用新案・無審査登録 } (1.5点)
- ④ ・ 拒絶査定を受け審判継続中
・ 出願中で権利未成立 (含む審査未請求)
で特許性に疑問のあるもの } (1点)
- ⑤ ・ 拒絶査定を受け訴訟継続中
・ 出願中で権利未成立 (含む審査未請求)
で特許性がないと判断できるもの } (0.5点)
- ⑥ 拒絶査定確定 (無効確定) (0点)

B. 権利の存続期間

- ① 15年以上 (2.5点)
- ② 10年以上 (2点)
- ③ 5年以上 (1.5点)
- ④ 3年以上 (1点)
- ⑤ 1年以上 (0.5点)
- ⑥ 1年未満又は失効 (0点)

○得点 (A+B) : _____点

2. 発明の技術的性格

<評価の視点>

- ・基本的技術の発明、大幅な改良技術の発明、小幅な改良技術の発明など、技術的性格、技術的インパクトのポジションを明らかにする。
- ・本指標は、あくまで技術的性格を明らかにするものであり、この指標における判断と発明の経済的な価値とは直接的な関係を想定していません。

<評価及びコメント>

<採点基準及び採点>

- | | |
|--------------|------|
| ①基本技術の発明 | (5点) |
| ②基本技術に準ずる発明 | (4点) |
| ③大幅な改良技術の発明 | (3点) |
| ④中程度の改良技術の発明 | (2点) |
| ⑤小幅な改良技術の発明 | (1点) |

○得点 : _____点

3. 代替技術との技術優位性

<評価の視点>

- ・本事項は代替技術との関連性を評価するものであり、明細書に記載の技術に関する代替技術の有無、また、代替技術がある場合、それとの比較における技術的優位性について判断する。

<評価及びコメント>

<評価基準及び採点>

- ①代替技術無し (5点)
- ②
- ③代替技術はあるが技術的には優位 (3点)
- ④
- ⑤代替技術があり技術的優位性が無い (1点)

○得点 : _____点

4. 特許の事業への寄与度

<評価の視点>

- ・当該発明を導入して製造する製品において、当該発明の占める技術的な寄与度はどの程度かをチェックする。部品の発明でそれ自体が単体で取引されないようなものであれば、それが用いられる製品への寄与度を考慮する。

<評価及びコメント>

<採点基準及び採点>

- ①非常に大きい (5点)
- ②大きい (4点)
- ③中程度 (3点)
- ④小さい (2点)
- ⑤非常に小さい (1点)

○得点 : _____点

5

5. 事業規模

< 評価の視点 >

- ・ 事業規模は事業化による収益性の大きさの度合い、すなわち事業規模の大きさを評価するものである。
- ・ この事業規模に関して、事業実施者の想定事業の市場規模とマーケットシェアから算出されるその大きさを評価の目安とすることができる。
- ・ 当該特許に基づき事業規模について、既存事業の事業規模を参考にして、その大きさを評価する。

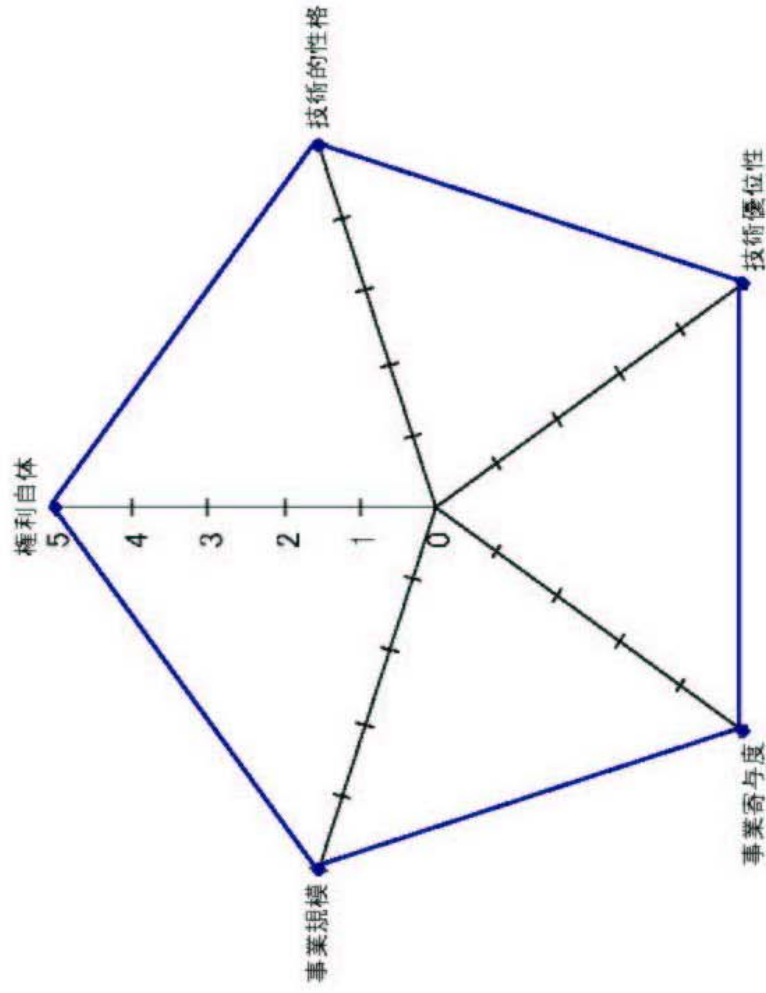
< 評価及びコメント >

< 採点基準及び採点 >

- ① 非常に大きい (5点)
- ② 大きい (4点)
- ③ 中程度 (3点)
- ④ 小さい (2点)
- ⑤ 非常に小さい (1点)

○ 得点 : _____ 点

Ⅲ. レーダーチャート



Ⅳ. 総合評価

得点 : ____点 (= 点 × 4)

ランク : A B C D E

ランク	得点(合計点)
A	80~100点
B	70~79点
C	50~69点
D	35~49点
E	34点以下

V. 特記事項：講評

以上

特許評価の実習共通課題(ケーススタディー)

例題: 特許第3015874号の特許評価

(簡易シート例を用いて実施)

実習共通課題

No.	項目	内容
A-1	発明の名称	液化ガス充填システム及び液化ガス充填車
A-2	特許 出願番号	特許 第3015874 特願平9-363258
A-3	出願日 存続期間	平成9年12月16日 年 月(平成 年 月 日現在)
A-4	出願人	
A-5	発明者	
A-6	作成日	平成 年 月 日
A-7	評価者	

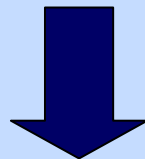
具体的調査内容

(1) 当該特許の検索：特許電子図書館(IPDL)の活用

(2) 他社特許の調査：特許電子図書館(IPDL)等の活用

(3) 市場性・事業規模調査

- ・ LPGの需要推移
- ・ 小口ユーザーのLPG需要見通し
- ・ バルクローリーの全国保有台数推移
- ・ 小口ユーザー向けバルクローリーの製造見直し



当該特許対象製品の年度別予測売上高

参考文献

- ・『特許電子図書館検索マニュアル』
（独立行政法人工業所有権情報・研修館）
- ・『特許流通支援チャート、パテントマップ活用ガイドブック』
（独立行政法人工業所有権情報・研修館）
- ・『パテントマップの戦略的活用術』
（技術情報協会）
- ・須藤実和著 『マーケティング実践講座』
（ダイヤモンド社）
- ・株式会社グロービス著 『MBAマーケティング』
（ダイヤモンド社：）